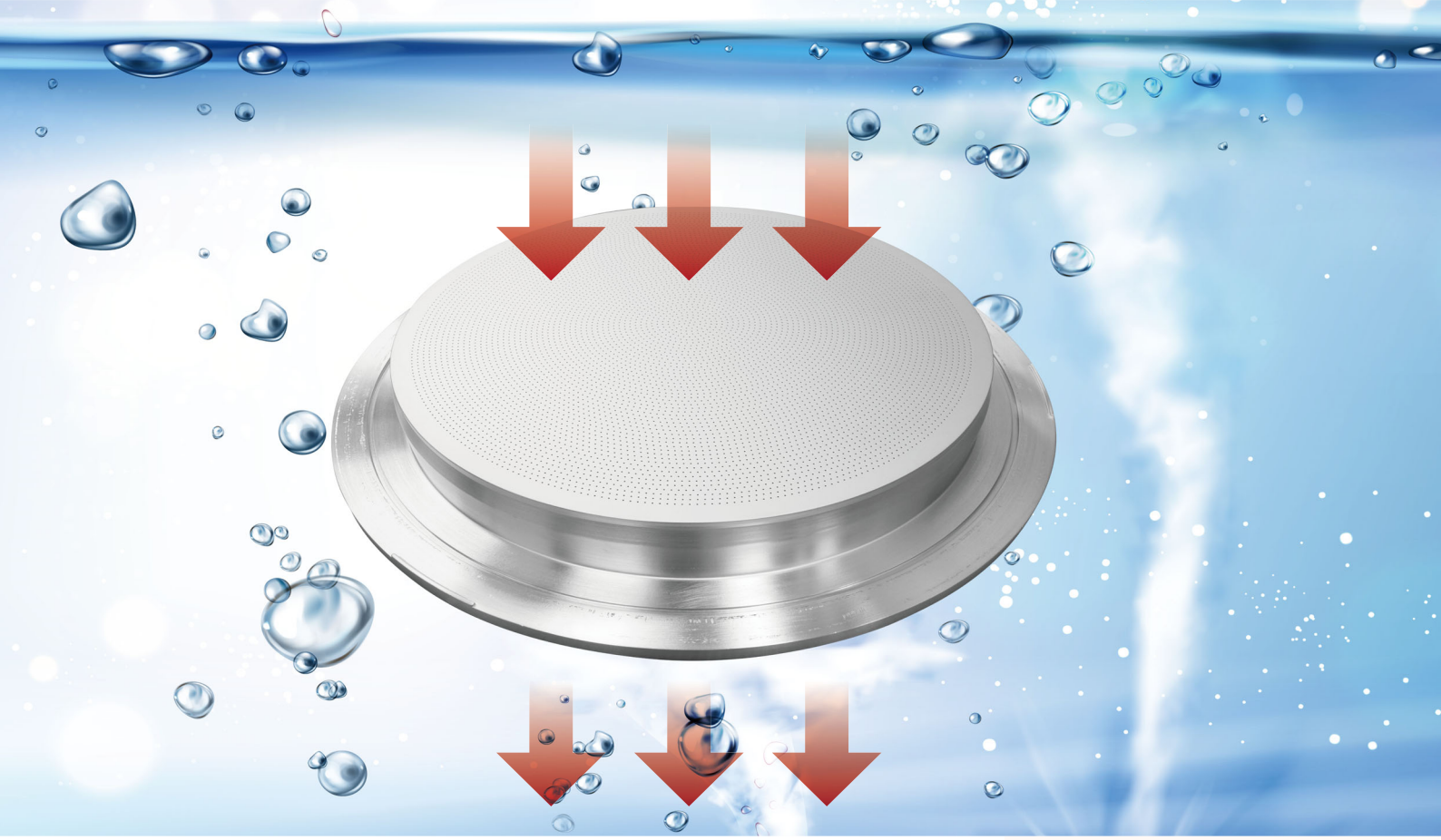


CIS™/ DIS™

Chemical / Deionized Water Injection System

특허 제10-1257482호

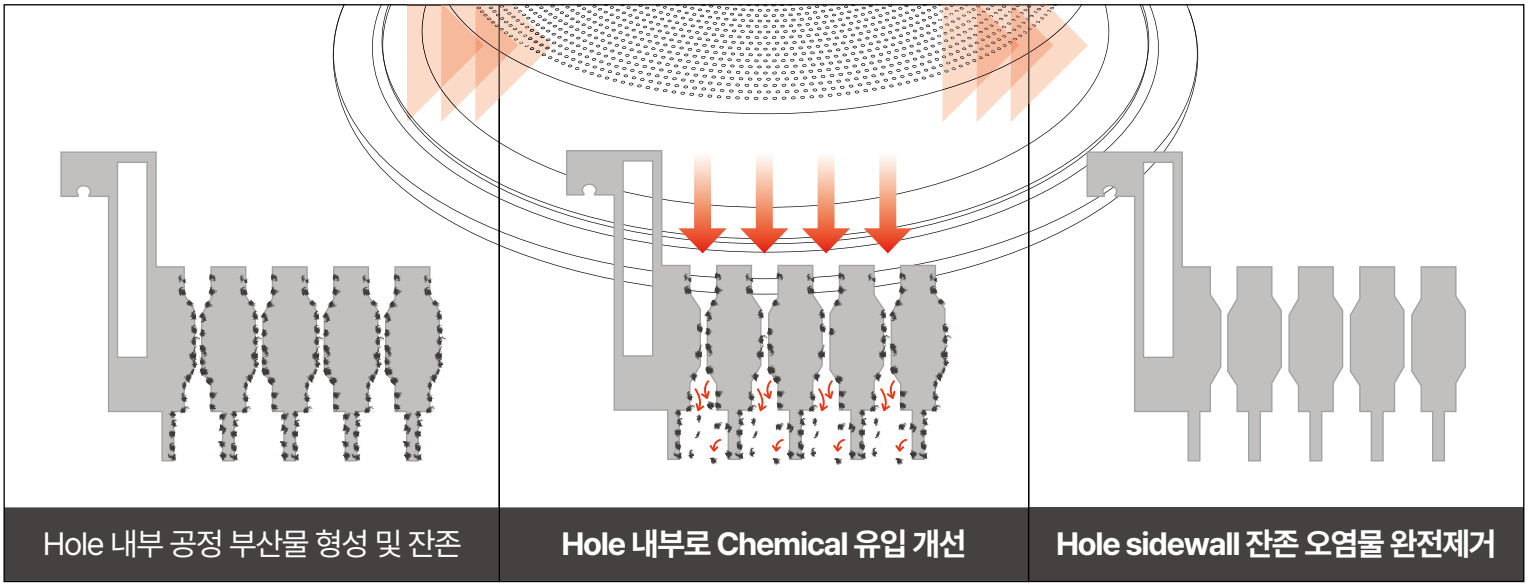
CIS™/DIS™는 다수의 미세한 Hole 내부의 화학적 세정을 위한 전용 세정 장치 입니다. Hole내부의 세정은 약액(세정액)의 높은 표면 에너지로 인하여 미세한 Hole내부까지 침투가 용이하지 않아 일반적인 침적 방식 등의 세정으로는 제거 불가능하며, 이로 인해 챔버 장착 시 Hole내부로부터 다량의 Particle이 발생됩니다. 표면 에너지를 개선한 전용 약액과 유체의 흐름 및 온도 제어를 통해 Hole크기 및 갯수 모양 등에 따른 CIS™/DIS™ 장비의 운용 제어가 가능하게 설계되어 완벽한 오염물 제거 효과를 얻을 수 있습니다.

Application

CIS™/DIS™는 Hole 전 제품 처리가능한 기술입니다.

CINOS

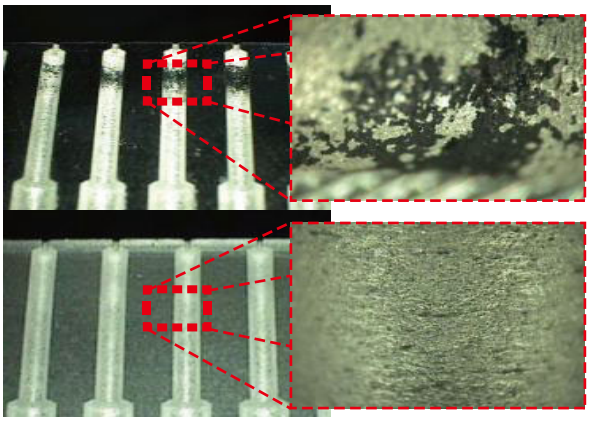
Method

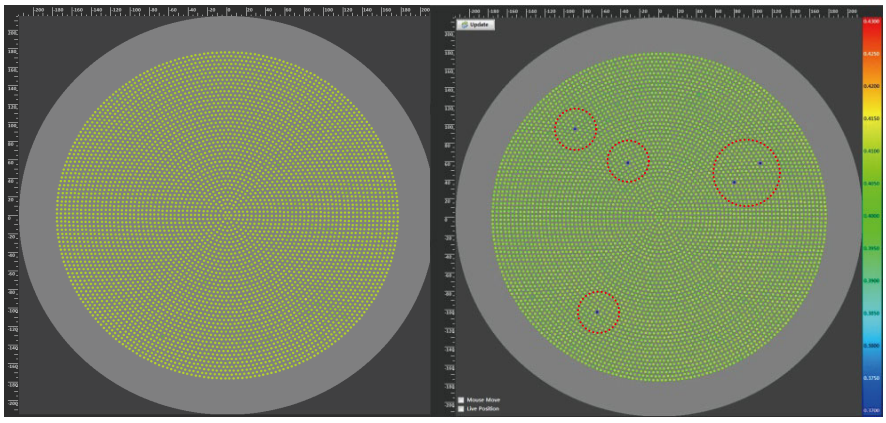


Hole 내부 공정 부산물 형성 및 잔존	Hole 내부로 Chemical 유입 개선	Hole sidewall 잔존 오염물 완전제거

Benefit

Hole 내부로 세정액이 효과적으로 순환 및 유입되어 세정액의 화학적 반응을 통해
내부에 잔존하는 오염 막질을 효과적으로 제거할 수 있습니다.





일반 세정 대비 Hole 내부
Particle 측정 결과

약 75% 개선

CINOS
C1 경기도 화성시 팔탄면 삼천병마로 517-19 C2 경기도 화성시 향남읍 발안공단로209 C3 경기도 화성시 향남읍 발안공단로4길 98-17
Tel. 031.366.3390 Fax. 031.366.3394 Web. www.cinoseng.com
Copyright by CINOS Co.,Ltd. All Rights Reserved.